

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成19年6月7日(2007.6.7)

【公開番号】特開2001-324826(P2001-324826A)

【公開日】平成13年11月22日(2001.11.22)

【出願番号】特願2000-144960(P2000-144960)

【国際特許分類】

G 0 3 G 5/05 (2006.01)

G 0 3 G 5/06 (2006.01)

【F I】

G 0 3 G 5/05 1 0 1

G 0 3 G 5/06 3 1 3

【手続補正書】

【提出日】平成19年4月16日(2007.4.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、繰り返し使用において、耐刷性、耐磨耗性、耐傷性、滑り性等の機械的性質に優れ、且つ、NO_x等の酸性ガス暴露後も表面抵抗値が高く保たれ、画像ボケ等を起こさず、高画質化の要求に即した電子写真感光体を提供することにある。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

(一般式(1)中、Ar₁及びAr₂は置換基を有しても良いベンゼン環を表し、Xは置換基を有しても良いアルキル基、アルケニル基、ベンゼン環、ナフタレン環、ビフェニル環のうちいずれか1種あるいは2種以上の混合体を表す。R₁及びR₂は、それぞれ水素原子、置換基を有していても良いアルキル基、アリール基のいずれか、またはR₁とR₂が連結した環状アルキリデン基を表す。)

一般式(1)において、R₁、R₂は、水素原子、炭素数3以下のアルキル基、シクロヘキシル基であることは好ましく、水素原子がより好ましい。Ar₁及びAr₂は無置換、または置換基を有するベンゼン環を表し、置換基を有する場合は3位、5位の少なくとも一つに炭素数5以下の低級アルキル基を有することが好ましく、特にメチル基を有することが好ましい。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0046

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0046】

これらの電荷発生物質は、単独でまたは2種類以上を組み合わせて用いることができる。

(4) 電荷輸送物質

本発明において、感光層に用いられる電荷輸送物質は、下記一般式（3）で表されるブタジエン系構造を有するものが用いられる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0048

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0048】

（一般式（3）中、 $X_1 \sim X_4$ は置換基を有しても良いフェニル基を表す。）

一般式（3）中、 $X_1 \sim X_4$ が有してもよい置換基の例としては、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジ（1-プロピル）アミノ基、ジ（2-プロピルアミノ）基、ジ（1-ブチル）アミノ基、ジベンジルアミノ基、ジフェニルアミノ基等が挙げられる。好ましい化合物の具体例を表-2に示す。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0051】

上記ブタジエン化合物を含有する電荷輸送層は、他の電荷輸送材料を用いた場合よりも、表面抵抗が高い特徴が有り、 NO_x ガス暴露後、表面抵抗は低下するものの、まだ十分大きいため、画像劣化に至らない。ここで、好ましい表面抵抗値としては、 NO_x 等のガス暴露後も、好ましくは 2×10^{13} オーム・m以上、より好ましくは 5×10^{13} オーム・m以上、さらに好ましくは 1×10^{14} オーム・m以上を保持していることが望ましい。